#### IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant(s): MIYAKE, Kunihito et al.

Filed: December 20, 2001 Examiner:

POLYBUTADIENE COMPOSITION For:

LETTER

Assistant Commissioner for Patents Box Patent Application Washington, D.C. 20231

December 20, 2001 2185-0604P-SP

Group:

Sir:

Under the provisions of 35 USC 119 and 37 CFR 1.55(a), the applicant hereby claims the right of priority based on the following application(s):

Country	Application No.	<u>Filed</u>	
JAPAN	2000-390712	12/22/00	
JAPAN	2000-390711	12/22/00	
JAPAN	2000-390710	12/22/00	

A certified copy of the above-noted application(s) is(are) attached hereto.

If necessary, the Commissioner is hereby authorized in this, concurrent, and future replies, to charge payment or credit any overpayment to deposit Account No. 02-2448 for any additional fees required under 37 C.F.R. 1.16 or under 37 C.F.R. 1.17; particularly, extension of time fees.

Respectfully submitted,

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

RAYMOND C. STEWART Req. No. 21,066

P. O. Box 747

Falls Church, Virginia 22040-0747

Attachment (703) 205-8000 /rem

Application No.:

日 PATENT **OFFICE**  IVIIVIAL, He exal 55K16 703-205.8000 Dec. 20, 200 1 2185-0604P

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載 いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2000年12月22日

出願 Application Number:

特願2000-390712

出 人 Applicant(s):

住友化学工業株式会社

2001年11月26日

Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】

特許願

【整理番号】

P152335

【提出日】

平成12年12月22日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

CO8K 5/07

【発明者】

【住所又は居所】 大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住友化学工業

株式会社内

【氏名】

三宅 邦仁

【発明者】

【住所又は居所】 大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住友化学工業

株式会社内

【氏名】

肥後 睦子

【特許出願人】

【識別番号】

000002093

【氏名又は名称】 住友化学工業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100093285

【弁理士】

【氏名又は名称】 久保山 隆

【電話番号】

06-6220-3405

【選任した代理人】

【識別番号】

100094477

【弁理士】

【氏名又は名称】 神野 直美

【電話番号】

06-6220-3405

【選任した代理人】

【識別番号】

100113000

【弁理士】

【氏名又は名称】 中山 亨

【電話番号】 06-6220-3405

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 010238

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9903380

【プルーフの要否】 要

### 【書類名】 明細書

【発明の名称】 ベンゾイン類を用いたスチレンーブタジエン共重合体成形品の 製造方法

### 【特許請求の範囲】

#### 【請求項1】

スチレンーブタジエン共重合体を、一般式(I)

$$Ar^{2} - C$$

$$CH - Ar^{1}$$

$$OH$$

$$OH$$

〔式中、 $A r^{1}$ および $A r^{2}$ はそれぞれ独立に芳香環を示す。〕

で示されるベンゾイン類と共に加熱し溶融したのち成形することを特徴とするスチレンーブタジエン共重合体成形品の製造方法。

### 【請求項2】

ベンゾイン類の使用量がスチレンーブタジエン共重合体100重量部あたり0 . 01重量部以上である請求項1に記載の製造方法。

#### 【請求項3】

スチレンーブタジエン共重合体がスチレンーブタジエンブロック共重合体である請求項1に記載の製造方法。

### 【請求項4】

射出成形法または押出成形法により成形する請求項1に記載の製造方法。

### 【請求項5】

ベンゾイン類がベンゾインである請求項1に記載の製造方法。

#### 【請求項6】

スチレンーブタジエン共重合体および前記一般式(I)で示されるベンゾイン類を含むことを特徴とするスチレンーブタジエン共重合体組成物。

#### 【請求項7】

ベンゾイン類の含有量がスチレンーブタジエン共重合体100重量部あたり0 01重量部以上である請求項6に記載の組成物。

#### 【請求項8】

ベンゾイン類がベンゾインである請求項6に記載の組成物。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、スチレンーブタジエン共重合体成形品の製造方法に関する。

[0002]

### 【従来の技術】

スチレンーブタジエン共重合体は、加硫ゴムと同程度の弾性、強度を示し、熱 可塑性を示すことから、熱可塑性樹脂と同様に加熱溶融されて成形され、各種成 形品として広く使用されている。

[0003]

しかし、スチレンーブタジエン共重合体は加熱下に熱劣化してゲル化物を生じ 易いという問題があった。かかるゲル化物は、成形後の成形品の外観不良などの 原因となるものである。

[0004]

### 【発明が解決しようとする課題】

そこで本発明者は、スチレンーブタジエン共重合体を加熱溶融してもゲル化物を生ずることなく成形して成形品を製造し得る方法を開発するべく鋭意検討した結果、スチレンーブタジエン共重合体をベンゾイン類と共に加熱溶融し成形することで、ゲル化物のない成形品が得られることを見出し、本発明に至った。

[0005]

#### 【課題を解決するための手段】

すなわち本発明は、スチレンーブタジエン共重合体を、一般式(I)

$$Ar^{2} - C \qquad CH - Ar^{1} \qquad (I)$$

〔式中、 $A r^{1}$ および $A r^{2}$ はそれぞれ独立に芳香環を示す。〕

で示されるベンゾイン類と共に加熱し溶融したのち成形することを特徴とするスチレンーブタジエン共重合体成形品の製造方法を提供するものである。

[0006]

### 【発明の実施の形態】

本発明の製造方法に用いられるスチレンーブタジエン共重合体は、例えばスチレンとブタジエンとをブロック共重合して得られるスチレンーブタジエンブロック共重合体であって、そのスチレン単位およびブタジエン単位の合計のうちのスチレン単位含有量は通常2~98重量%であり、ブタジエン単位含有量は通常98~2重量%である。

## [0007]

一般式(I)で示されるベンゾイン類において $Ar^1$ および $Ar^2$ はそれぞれ独立に芳香環を示すが、芳香環として具体的にはベンゼン環などが挙げられる。ここでベンゼン環は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシル基、アルコキシアルコキシル基などで置換されていてもよい。

### [0008]

かかるベンゾイン類(I)としては、例えばベンゾイン、3' ーヒドロキシベンゾイン、4, 4' ージメトキシベンゾイン、4, 4' ービス(メトキシメトキシ)ベンゾインなどが挙げられる。

### [0009]

本発明の製造方法は、かかるスチレンーブタジエン共重合体をベンゾイン類(I)とともに加熱し溶融する。加熱し溶融するには、例えばスチレンーブタジエン共重合体およびベンゾイン類(I)を含むスチレンブタジエン共重合体組成物を加熱し溶融混練すればよい。

### [0010]

スチレンブタジエン共重合体組成物としては、例えばスチレン-ブタジエン共 重合体の粒子およびベンゾイン類の粒子の混合物を用いることができる。混合物 は、例えば一軸混練機などにより加熱しながら溶融し混練することができる。

### [0011]

かくしてスチレンーブタジエン共重合体およびベンゾイン類が均一に混合され、スチレンーブタジエン共重合体にベンゾイン類が均一に分散されるが、スチレンーブタジエン共重合体およびベンゾイン類(I)からなるスチレンブタジエン

共重合体組成物は、このようにスチレンーブタジエン共重合体にベンゾイン類が 均一に分散された組成物であってもよい。

# [0012]

ベンゾイン類の使用量はスチレンーブタジエン共重合体100重量部あたり通常0.01重量部以上であり、好ましくは0.05重量部以上である。ベンゾイン類の使用量は、スチレンーブタジエン共重合体組成物を加熱溶融して成形しえるのであれば特にその上限はないが、10重量部を超えてもそれに見合う効果が得られない傾向にあるため実用的には通常は10重量部以下、好ましくは5重量部以下である。

# [0013]

本発明の製造方法は、スチレンーブタジエン共重合体とベンゾイン類とを、スチレンーブタジエン共重合体に通常使用されると同様の添加剤、例えばフェノール系酸化防止剤、リン系酸化防止剤、イオウ系酸化防止剤などの酸化防止剤、紫外線吸収剤、光安定剤、帯電防止剤、難燃剤、顔料、染料などの着色剤、充填剤などと共に加熱し、溶融してもよい。

### [0014]

[0015]

2, 4 - ジオクチルチオメチルー6 - t - ブチルフェノール、2, 4 - ジオクチルチオメチルー6 - メチルフェノール、2, 4 - ジオクチルチオメチルー6 - エチルフェノール、2, 6 - ジドデシルチオメチルー4 - ノニルフェノールおよびそれらの混合物などのアルキルチオメチルフェノール、

[0016]

2, 6-ジ-t-ブチル-4-メトキシフェノール、<math>2, 5-ジ-t-ブチルヒドロキノン、<math>2, 5-ジ-t
ズクタデシルオキシフェノール、<math>2, 6-ジ-t
ズクタデシルオキシフェノール、<math>2, 6-ジ-t
ズチルヒドロキノン、<math>2, 5-ジ-t
ベージーナーブチルー4ーヒドロキシアニソール、<math>2, 5-ジ-t
ベージーカー ステアレート、ビス(<math>3, 5-ジ-t
ベーブチルー4ーヒドロキシフェニル アジペートおよびそれらの混合物などのヒドロキノン及びアルキル化ヒドロキノン、

[0017]

 $\alpha$  ートコフェロール、 $\beta$  ートコフェロール、 $\gamma$  ートコフェロール、 $\delta$  ートコフェロールおよびそれらの混合物などのトコフェロール、

[0018]

2, 2' -チオビス(6-t-ブチルフェノール)、2, 2' -チオビス(4-メチル-6-t-ブチルフェノール)、2, 2' -チオビス(4-オクチルフェノール)、4, 4' -チオビス(3-メチル-6-t-ブチルフェノール)、4, 4' -チオビス(2-メチル-6-t-ブチルフェノール)、4, 4' -5オビス(3, 6-ジ-t-アミルフェノール)、4, 4' -0 (2, 6-ジメチルー4-ヒドロキシフェニル)ジスルフィドなどのヒドロキシル化チオジフェニルエーテル、

[0019]

2, 2' -メチレンビス(4 -メチル-6 - t -ブチルフェノール)、2, 2' -メチレンビス(4 -エチル-6 - t -ブチルフェノール)、2, 2' -メチレンビス [4 -メチル-6 - ( $\alpha$  -メチルシクロヘキシル)フェノール)]、2, 2' -メチレンビス(4 -メチル-6 -シクロヘキシルフェノール)、2, 2'

ーメチレンビス(4ーメチルー6ーノニルフェノール)、2,2'ーメチレンビ ス(4,6ージーtーブチルフェノール)、2,2'ーエチリデンビス(4,6 ージーtーブチルフェノール)、2,2'ーエチリデンビス(4ーイソブチルー 6-t-7チルフェノール)、2,2'ーメチレンビス[6-(α-x)チルベン ジル) -4-1ニルフェノール]、2, 2'ーメチレンビス  $[6-(\alpha, \alpha-i)]$ メチルベンジル) -4-ノニルフェノール]、4,4'-メチレンビス(6-t ーブチルー2ーメチルフェノール)、4,4'ーメチレンビス(2,6ージーt ーブチルフェノール)、4,4'ーブチリデンビス(3ーメチルー6ーtーブチ , 1-ビス(5-t-ブチルー4-ヒドロキシー2ーメチルフェニル)ブタン、 2, 6-ビス(3-t-ブチル-5-メチル-2-ヒドロキシベンジル)-4-メチルフェノール、1, 1, 3ートリス(5ーt-ブチルー4-ヒドロキシー2 ーメチルフェニル) ブタン、1, 1ービス(5ーtーブチルー4ーヒドロキシー 2-メチルフェニル) -3-n-ドデシルメルカプトブタン、エチレングリコー ル ビス[3,3-ビス-3'-t~ブチル-4'-ヒドロキシフェニル)ブチ レート]、ビス(3-t-ブチル-4-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)ジシ クロペンタジエン、ビス[2-(3'-t-ブチル-2'-ヒドロキシ-5'-メチルベンジル) -6-t-ブチル-4-メチルフェニル] テレフタレート、1 , 1ービス(3, 5ージメチルー2ーヒドロキシフェニル)ブタン、2, 2ービ ス(3,5-ジーtーブチルー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビ ス(5-t-ブチル-4-ヒドロキシ-2-メチルフェニル)-4-n-ドデシ ルメルカプトブタン、1,1,5,5ーテトラ(5ーtーブチルー4ーヒドロキ シー2-メチルフェニル)ペンタン、2-t-ブチル-6-(3'-t-ブチル -5'-メチル-2'-ヒドロキシベンジル)-4-メチルフェニル アクリレ -1, 2, 4-9-t-40+1-6-[1-(2-1)+1-3, 5-9-1]t - ペンチルフェニル) エチル] フェニル アクリレートおよびそれらの混合物 などのアルキリデンビスフェノールおよびその誘導体、

[0020]

3, 5, 3', 5'ーテトラーtーブチルー4, 4'ージヒドロキシジベンジル

エーテル、オクタデシルー4ーヒドロキシー3, 5-ジメチルベンジルメルカプトアセテート、トリス(3, <math>5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシベンジル)アミン、ビス(4ーtーブチルー3ーヒドロキシー2, <math>6-ジメチルベンジル)ジチオテレフタレート、ビス(3, <math>5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシベンジル)スルフィド、イソオクチルー3, <math>5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシベンジルメルカプトアセテートおよびそれらの混合物などの<math>O-ベンジル誘導体、N-ベンジル誘導体および<math>S-ベンジル誘導体、

[0021]

ジオクタデシルー2, 2-ビス(3, 5-ジ-t-ブチルー2-ヒドロキシベンジル) マロネート、ジオクタデシルー2 - (3-t-ブチルー4-ヒドロキシー5-メチルベンジル) マロネート、ジドデシルメルカプトエチルー2, 2-ビス(3, 5-ジ-t-ブチルー4-ヒドロキシベンジル) マロネート、ビス [4-(1,1,3,3-F)トラメチルブチル)フェニル] -2, 2-ビス(3, 5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシベンジル) マロネートおよびそれらの混合物などのヒドロキシベンジル化マロネート誘導体、

[0022]

1, 3, 5-トリメチル-2, 4, 6-トリス(3, 5-ジーt-ブチル-4-ヒドロキシベンジル)ベンゼン、1, 4-ビス(3, 5-ジーt-ブチル-4-ヒドロキシベンジル)-2, 3, 5, 6-テトラメチルベンゼン、2, 4, 6-トリス(3, 5-t-ブチル-4-ヒドロキシベンジル)フェノールおよびそれらの混合物などの芳香族ヒドロキシベンジル誘導体、

[0023]

2,  $4-\forall \lambda$ ,  $(n-\lambda \rho + \lambda \rho$ 

、トリス(3, 5-ジ-t-ブチルー4-ヒドロキシベンジル)イソシアヌレート、2, 4, 6-トリス(3, <math>5-ジ-t-ブチルー4-ヒドロキシフェニルエチル)-1, 3, <math>5-トリアジン、2, 4, 6-トリス(3, 5-ジ-t-ブチルー4-ヒドロキシフェニルプロピル)-1, 3, <math>5-トリアジン、トリス(3, 5-ジシクロヘキシルー4-ヒドロキシベンジル)イソシアヌレート、トリス[2-(3', 5'-ジーt-ブチルー4'-ヒドロキシシンナモイルオキシ)エチル]イソシアヌレートおよびそれらの混合物などのトリアジン誘導体、

[0024]

ジメチルー3, 5ージーtーブチルー4ーヒドロキシベンジルホスホネート、ジエチルー3, 5ージーtーブチルー4ーヒドロキシベンジルホスホネート、ジオクタデシルー3, 5ージーtーブチルー4ーヒドロキシベンジルホスホネート、ジオクタデシルー5ーtーブチルー4ーヒドロキシー3ーメチルベンジルホスホネート、3, 5ージーtーブチルー4ーヒドロキシベンジルホスホン酸モノエステルのカルシウム塩およびそれらの混合物などのベンジルホスホネート誘導体、

[0025]

4-ヒドロキシラウリル酸アニリド、4-ヒドロキシステアリン酸アニリド、オクチル-N-(3,5-ジーt-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)カルバネートおよびそれらの混合物などのアシルアミノフェノール誘導体、

[0026]

 , 2] オクタンおよびそれらの混合物などの一価アルコールまたは多価アルコールとのエステル、

[0027]

[0028]

[0029]

3, 5-ジーtーブチルー4-ヒドロキシフェニル酢酸と メタノール、エタノール、オクタノール、オクタデカノール、エチレングリコー ル、1, 3-プロパンジオール、1, 4-ブタンジオール、1, 6-ヘキサンジオール、1, 9-ノナンジオール、ネオペンチルグリコール、ジエチレングリコール、チオエチレングリコール、スピログリコール、トリエチレングリコール、ペンタエリスリトール、トリス(ヒドロキシエチル)イソシアヌレート、N, N ービス(ヒドロキシエチル)オキサミド、3-チアウンデカノール、3-チアペンタデカノール、トリメチルヘキサンジオール、トリメチロールプロパン、4-ヒドロキシメチル-1-ホスファ-2, 6, 7-トリオキサビシクロ [2, 2] オクタンおよびそれらの混合物などの一価アルコールまたは多価アルコールとのエステル、

[0030]

N, N'ービス [3-(3',5'ージーtーブチルー4'ーヒドロキシフェニル)プロピオニル]ヒドラジン、N, N'ービス [3-(3',5'ージーtーブチルー4'ーヒドロキシフェニル)プロピオニル]へキサメチレンジアミン、N, N'ービス [3-(3',5'ージーtーブチルー4'ーヒドロキシフェニル)プロピオニル]トリメチレンジアミンおよびそれらの混合物などのβー(3,5-ジーtーブチルー4ーヒドロキシフェニル)プロピオン酸のアミドなどが挙げられる。かかるフェノール系酸化防止剤それぞれ単独または2種以上を混合して用いられる。

[0031]

リン系酸化防止剤としては、例えばトリフェニルホスファイト、トリス (ノニルフェニル) ホスファイト、トリス (2, 4ージーtーブチルフェニル) ホスファイト、トリス (2, 4ージーtーブチルフェニル) ホスファイト、トリテウリルホスファイト、トリオクタデシルホスファイト、ジステアリル ペンタエリスリトール ジホスファイト、ビス (2, 4ージーtーブチルフェニル) ペンタエリスリトール ジホスファイト、ビス (2, 4ージーtーブチルー6ーメチルフェニル) ペンタエリスリトール ジホスファイト、ビス (2, 6ージーtーブチルー4ーメチルフェニル) ペンタエリスリトール ジホスファイト、ビス (2, 4, 6ートリーtーブチルフェニル) ペンタエリスリトール ジホスファイト、トリステアリルソルビトールトリホスファイト、テトラキス (2, 4ージーtーブ

チルフェニル) -4, 4' -ジフェニレンジホスホナイト、2, 2' -メチレンビス(4, 6-ジーtーブチルフェニル) 2-エチルヘキシル ホスファイト、2, 2' -エチリデンビス(4, 6-ジーtーブチルフェニル) フルオロ ホスファイト、ビス(2, 4-ジーtーブチルー6-メチルフェニル) エチルホスファイト、ビス(2, 4-ジーtーブチルー6-メチルフェニル) メチルホスファイト、ビス(2, 4-ジーtーブチルー6-メチルフェニル) メチルホスファイト、2-(2, 4, 6-トリーtーブチルフェニル) -5-エチルー5ーブチルー1, 3, 2-オキサホスホリナン、2, 2', 2''ーニトリロ[トリエチルートリス(3, 3', 5, 5'ーテトラーtーブチルー1, 1'ービフェニルー2, 2'ージイル) ホスファイトおよびそれらの混合物などが挙げられる。かかるリン系酸化防止剤はそれぞれ単独または2種以上を混合して用いられる。

[0032]

イオウ系酸化防止剤としては、例えばジラウリル 3,3'ーチオジプロピオネート、トリデシル 3,3'ーチオジプロピオネート、ジミリスチル 3,3'ーチオジプロピオネート、ジステアリル 3,3'ーチオジプロピオネート、ラウリル ステアリル 3,3'ーチオジプロピオネート、ネオペンタンテトライルテトラキス(3ーラウリルチオプロピオネート)などが挙げられる。

紫外線吸収剤としては、例えばフェニル サリシレート、4ーtーブチルフェニル サリシレート、2,4ージーtーブチルフェニル 3',5'ージーtーブチルー4'ーヒドロキシベンゾエート、4ーtーオクチルフェニル サリシレート、ビス(4ーtーブチルベンゾイル)レゾルシノール、ベンゾイルレゾルシノール、ヘシサデシル 3',5'ージーtーブチルー4'ーヒドロキシベンゾエート、オクタデシル 3',5'ージーtーブチルー4'ーヒドロキシベンゾエート、2ーメチルー4,6ージーtーブチルフェニル 3',5'ージーtーブチルー4'ーヒドロキシベンゾエートおよびそれらの混合物などのサリシレート誘導体、

[0033]

2, 4 - ジヒドロキシベンゾフェノン、2 - ヒドロキシー4 - メトキシベンゾフェノン、2 - ヒドロキシー4 - オクトキシベンゾフェノン、2, 2' - ジヒドロ

キシー4ーメトキシベンゾフェノン、ビス(5ーベンゾイルー4ーヒドロキシー 2ーメトキシフェニル)メタン、2, 2', 4, 4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノンおよびそれらの混合物などの2ーヒドロキシベンゾフェノン誘導体、

[0034]

2-(2-ヒドロキシー5-メチルフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(3' **, 5' -ジ-t-ブチル-2' -ヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾール、2** - (5'-t-ブチル-2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシー5'-t-オクチルフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(3-t-ブチルー2-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)-5-クロロベンゾ トリアゾール、2-(3'-s-ブチル-2'-ヒドロキシ-5'-tーブチル フェニル)ベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-4'-オクチルオキ シフェニル) ベンゾトリアゾール、2-(3',5'-ジーt-アミル-2'-ヒドロキシフェニル) ベンゾトリアゾール、2-[2'-ヒドロキシ-3', 5 'ービス(α, αージメチルベンジル)フェニル] ー2Η-ベンゾトリアゾール 、2-[(3'-t-ブチル-2'-ヒドロキシフェニル)-5'-(2-オク チルオキシカルボニルエチル)フェニル]-5-クロロベンゾトリアゾール、2 - 「3'-t-ブチル-5'- [2-(2-エチルヘキシルオキシ)カルボニル エチル]-2'-ヒドロキシフェニル]-5-クロロベンゾトリアゾール、2-「3'-t-ブチルー2'-ヒドロキシー5'- (2-メトキシカルボニルエチ ル)フェニル] - 5 - クロロベンゾトリアゾール、2 - 「3' - t - ブチルー2 **'ーヒドロキシー5'ー(2-メトキシカルボニルエチル)フェニル]ベンゾト** リアゾール、2-[3'-t-ブチル-2'-ヒドロキシ-5-(2-オクチル オキシカルボニルエチル)フェニル]ベンゾトリアゾール、2-[3'-t-ブ チルー2'ーヒドロキシー5'ー「2-(2-エチルヘキシルオキシ)カルボニ ルエチル]フェニル]ベンゾトリアゾール、2-[2-ヒドロキシ-3-(3, 4, 5, 6ーテトラヒドロフタルイミドメチル) - 5ーメチルフェニル] ベンゾ トリアゾール、2-(3,5-ジーtーブチルー2-ヒドロキシフェニル)-5 ークロロベンゾトリアゾール、2-(3'ードデシル-2'ーヒドロキシ-5' ーメチルフェニル)ベンゾトリアゾールおよび2-[3'-t-ブチル-2'-

ヒドロキシ-5'-(2-イソオクチルオキシカルボニルエチル)フェニル]ベ ンゾトリアゾールの混合物、2,2'ーメチレンビス[6-(2H-ベンゾトリ アゾールー2ーイル)ー4ー(1,1,3,3ーテトラメチルブチル)フェノー ル、2,2'ーメチレンビス[4-t-ブチルー6-(2H-ベンゾトリアゾー [3'-t-ブチルー2'-ヒドロキシー5'-(2-メトキシカルボニルエチ ル)フェニル]ベンゾトリアゾールとの縮合物、ポリ(3~11) (エチレング リコール) とメチル 3-[3-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-5 - t - ブチル-4-ヒドロキシフェニル] プロピオネートとの縮合物、2-エチ ルヘキシル 3-[3-t-ブチル-5-(5-クロロ-2H-ベンゾトリアゾ ールー2ーイル) -4-ヒドロキシフェニル] プロピオネート、オクチル 3--4-ヒドロキシフェニル] プロピオネート、メチル 3-[3-t-ブチルー 5-(5-クロロ-2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフ ェニル] プロピオネート、3-[3-t-ブチル-5-(5-クロロ-2H-ベ ンゾトリアゾールー2ーイル)-4-ヒドロキシフェニル]プロピオン酸および それらの混合物などの2-(2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾールな どが挙げられる。かかる紫外線吸収剤はそれぞれ単独または2種以上を混合して 用いられる。

[0.035]

光安定剤としては、例えばビス(2,2,6,6ーテトラメチルー4ーピペリジル) セバケート、ビス((2,2,6,6ーテトラメチルー4ーピペリジル) スクシネート、ビス(1,2,2,6,6ーペンタメチルー4ーピペリジル) セバケート、ビス(Nーオクトキシー2,2,6,6ーテトラメチルー4ーピペリジル) セバケート、ビス(Nーベンジルオキシー2,2,6,6ーテトラメチルー4ーピペリジル) セバケート、ビス(Nーベンジルオキシー2,2,6,6ーテトラメチルー4ーピペリジル) セバケート、ビス(Nーシクロヘキシルオキシー2,2,6,6ーテトラメチルー4ーピペリジル) セバケート、ビス(1,2,2,6,6ーペンタメチルー4ーピペリジル) 2ー(3,5ージー t-7 チルー4ーピペリジル) 2ーグチルマロネート、ビス(1ーアクロイルー2,6ーピペリジル) 1ーピャクロイルー2

2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル) 2, 2-ビス(3, 5-ジー t-ブチルー4-ヒドロキシベンジル) -2-ブチルマロネート、ビス(1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチルー4-ピペリジルデカンジオエート、2, 2, 6, 6-テトラメチルー4-ピペリジル メタクリレート、4-[3-(3, 5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシフェニル)プロピオニルオキシ] -1-[2-(3-(3, 5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシフェニル)プロピオニルオキシ)エチル] -2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン、2-メチルー2-(2, 2, 6, 6-テトラメチルー4-ピペリジル)アミノーNー(2, 2, 6, 6-テトラメチルー4-ピペリジル)プロピオンアミド、テトラキス(2, 2, 2, 3, 4-ブタンテトラカルボキシレート、テトラキス(1, 2, 2, 4, 4-ブタンテトラカルボキシレート、テトラキス(4, 4-ブタンテトラカルボキシレート、テトラキス(4, 4-ブタンテトラカルボキシレート、4-ブタンテトラカルボン酸と4-ブタンテトラカルボキシレート、4-ブタンテトラカルボン酸と4-ブタンテトラカルボン酸と4-ビペリジノールおよび4-トリデカノールとの混合エステル化物、

[0036]

1, 2, 3, 4ーブタンテトラボン酸と2, 2, 6, 6ーテトラメチルー4ーピペリジノールおよび1ートリデカノールとの混合エステル化物、1, 2, 3, 4ーブタンテトラカルボン酸と1, 2, 2, 6, 6ーペンタメチルー4ーピペリジノールおよび3、9ービス(2ーヒドロキシー1, 1ージメチルエチル)ー2, 4, 8, 10ーテトラオキサスピロ[5・5]ウンデカンとの混合エステル化物、1, 2, 3, 4ーブタンテトラカルボン酸と2, 2, 6, 6ーテトラメチルー4ーピペリジノールおよび3, 9ービス(2ーヒドロキシー1, 1ージメチルエチル)ー2, 4, 8, 10ーテトラオキサスピロ[5・5]ウンデカンとの混合エステル化物、ジメチルサクシネートと1ー(2ーヒドロキシエチル)ー4ーヒドロキシー2, 2, 6, 6ーテトラメチルピペリジンとの重縮合物、ポリ[(6ーモルホリノー1, 3, 5ートリアジンー2, 4ージイル)((2, 2, 6, 6ーテトラメチルー4ーピペリジル)イミノ)へキサメチレン((2, 2, 6, 6ーテトラメチルー4ーピペリジル)イミノ)]、ポリ[(6ー(1, 1, 3, 3ーテトラメチルブチル)イミノー1, 3, 5ートリアジンー2, 4ージイル((

2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル)イミノ)ヘキサメチレン(( 2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル) イミノ))、N, N'-ビス (2, 2, 6, 6-テトラメチルー4-ピペリジル) ヘキサメチレンジアミンと 1, 2-ジブロモエタンとの重縮合物、N, N', 4, 7-テトラキス[4, 6 -ビス (N-ブチル-N- (2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル)アミノ) -1, 3, 5-トリアジン-2-イル] -4, 7-ジアザデカン-1, 10ジアミン、N, N', 4-トリス[4,6-ビス(N-ブチル-N-(2, 2, 6, 6ーテトラメチルー4ーピペリジル)アミノ)ー1,3,5ートリアジ ン-2-4ル] -4, 7-ジアザデカン-1, 10-ジアミン、N, N, 4, 7-テトラキス [4, 6-ビス (N-ブチル-N-(1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチルー4ーピペリジル) アミノ) ー1, 3, 5ートリアジンー2ーイル] ー 4, 7-ジアザデカン-1, 10-ジアミン、N, N', 4-トリス[4, 6-ビス (N-ブチル-N-(1, 2, 2, 6, 6ーペンタメチル-4-ピペリジル ) アミノ) -1, 3, 5-トリアジン-2-イル] -4, 7-ジアザデカン-1, 10-ジアミンおよびそれらの混合物などのヒンダードアミン系光安定剤、 エチル  $\alpha$  - シアノー $\beta$ ,  $\beta$  - ジフェニルアクリレート、イソオクチル  $\alpha$  - シ PJ-β, β-ジフェニルアクリレート、メチル α-カルボメトキシシンナメ -ト、メチルα-シアノ-β-メチル-р-メトキシシンナメート、ブチル $\alpha$ ーシアノーβーメチルーpーメトキシシンナメート、メチル αーカルボメトキ シーρーメトキシシンナメートおよびΝー (β-カルボメトキシーβ-シアノビ ニル) -2-メチルインドリンおよびそれらの混合物などのアクリレート系光安 定剤、

[0037]

2, 2'ーチオビスー[4ー(1, 1, 3, 3ーテトラメチルブチル)フェノール]のニッケル錯体、ニッケルジブチルジチオカルバメート、モノアルキルエステルのニッケル塩、ケトキシムのニッケル錯体およびそれらの混合物などのニッケル系光安定剤、

[0038]

4, 4'-ジオクチルオキシオキサニリド、2, 2'-ジエトキシオキサニリド

、2,2'-ジオクチルオキシー5,5'-ジーt-ブチルアニリド、2,2'-ジドデシルオキシー5,5'-ジーt-ブチルアニリド、2-エトキシー2'-エチルオキサニリド、N,N'-ビス (3-ジメチルアミノプロピル)オキサミド、2-エトキシー5-t-ブチルー2'-エトキシアニリド、2-エトキシー5,4'-ジーt-ブチルー2'-エチルオキサニリドおよびそれらの混合物などのオキサミド系光安定剤、

[0039]

[0040]

かくして得られるスチレンーブタジエン共重合体およびベンゾイン類を含むスチレンーブタジエン共重合体組成物は、ベンゾイン類の含有量がスチレンーブタジエン共重合体100重量部あたり通常0.01重量部以上、好ましくは0.05重量部以上であり、実用的には10重量部以下、好ましくは5重量部以下である。

[0041]

かくして加熱し溶融したのち成形する。成形は、加熱し、溶融後に一旦冷却したのちに行なってもよいし、加熱、溶融後に再度加熱して溶融状態としてから成形してもよい。成形方法は特に限定されるものではなく、通常と同様に例えば射出成形法、押出成形法などの方法により成形することができる。

かくして成形することにより、目的とするスチレンーブタジエン共重合体成形品を得ることができる。かかる成形品は、ゲル化物がなく、外観不良もないので、例えばホース、履物、玩具、フィルム、容器などに好適に使用することができる。

[0042]

# 【発明の効果】

本発明の製造方法によれば、スチレンーブタジエン共重合体をベンゾイン類と 共に加熱し溶融したのちに成形しているので、ゲル化物が生じず、ゲル化物のな い成形品得ることができる。

[0043]

### 【実施例】

以下、実施例により本発明をより詳細に説明するが、本発明はかかる実施例に 限定されるものではない。

[0044]

#### 実施例1

スチレンーブタジエンブロック共重合体 [スチレン単位含有量は75重量%、 ブタジエン単位含有量は25重量%、淡黄色透明、フィリップス社製、「K-R e s i n KR-05」] の粉末100重量部に式(1)

$$\begin{array}{c}
0 \\
CH \\
OH
\end{array}$$
(1)

で示される化合物 [ベンゾイン] (粉末状) 0.1 重量部を添加した。次いで、30 mm φ 一軸押出機を用いて200℃で<u>約2分間</u>溶融混練しペレット化して、ペレット状のスチレンーブタジエン共重合体組成物を得た。このペレット状の組成物のMFRを、上記メルトインデクサー [「L246-2531」] を用いて

260℃で荷重2160g、滞留時間15分として測定したところ、38g/10分であった。

上記で得たペレットを加熱し溶融混練し、射出成形して得られる成形体は、ゲル化物がなく、外観も良好である。

[0045]

# 比較例1

ベンゾインを用いることなくスチレンーブタジエンブロック共重合体を溶融混練する以外は実施例1と同様に操作して、スチレンーブタジエンブロック共重合体のペレットを得た。このペレットのMFRを上記メルトインデクサー〔「L246-2531」〕を用いて260℃で荷重2160g、滞留時間15分として測定したところ、4g/10分であった。

上記で得たペレットを加熱し溶融混練し、射出成形して得られる成形体は、ゲル化物が多く存在し、該ゲル化物に起因して表面に微細な凸部が発生している。

[0046]

以上の結果を表1にまとめて示す。

[0047]

【表1】

	実施例 1	比較例 1
スチレンーブタジエン ブロック共重合体 (重量部)	100	100
ベンゾイン(重量部)	0.1	
MFR (g/10分)	3 8	4

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 スチレンーブタジエン共重合体を加熱溶融してもゲル化物を生ずることなく成形して成形品を製造し得る方法を提供する。

【解決手段】 スチレン-ブタジエン共重合体を、一般式(I)

〔式中、 $A r^{1}$ および $A r^{2}$ はそれぞれ独立に芳香環を示す。〕

で示されるベンゾイン類と共に加熱し溶融したのち成形する。ベンゾイン類の使用量はスチレンーブタジエン共重合体100重量部あたり通常0.01重量部以上である。射出成形、押出成形により成形することができる。ベンゾイン類としてはベンゾインが好適である。

【選択図】 なし

# 出願人履歴情報

識別番号

[000002093]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

氏 名

住友化学工業株式会社